

強磁性体で両側を挟まれた超伝導薄膜*

永井佑紀

平成 17 年 8 月 15 日

強磁性体で両側を挟まれた厚さ d の一様な超伝導薄膜を考える。

1. 膜面に平行な磁場 H がかった場合の GL 方程式を書け
2. $H = 0$ のとき、波動関数の境界条件 $\psi(\pm d/2) = 0$ のもとに線形化された GL 方程式を解くことによって、この薄膜の転移温度 T_c (バルクの転移温度 T_{c0} よりも低くなる) を求めよ。
3. 平行磁場 H のもとで上部臨界磁場を求めよ。その温度依存性を明示的に表せ。
(磁場による「調和ポテンシャルの項」のエネルギーへの寄与をその平均値で近似する)

という問題を解くことにする。

ここでは Gauss 単位系を用いる。

1 GL 方程式を書く

1.1 GL 方程式

超伝導体の自由エネルギーを

$$F - F_n = \int d\mathbf{r} \left[\alpha|\psi|^2 + \frac{\beta}{2}|\psi|^4 + \frac{1}{2m^*} \left| \left(\frac{\hbar}{i} \nabla - \frac{e^*}{c} \mathbf{A} \right) \psi \right|^2 + \frac{(\text{rot} \mathbf{A})^2}{8\pi} \right] \quad (1)$$

と置けば、GL 方程式は

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \left(\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} - \frac{ie^*}{\hbar c} \mathbf{A} \right)^2 \psi = -\alpha\psi - \beta|\psi|^2\psi \quad (2)$$

となる。 $H \parallel z$ と仮定し、薄膜は $-\frac{1}{2}d < x < \frac{1}{2}d$ の体積を占めるものとする。このときベクトルポテンシャル \mathbf{A} は

$$\mathbf{A} = (0, Hx, 0) \quad (3)$$

とおける。これを GL 方程式に代入すると

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \left(\frac{d^2}{dx^2} + \frac{d^2}{dy^2} + \frac{d^2}{dz^2} \right) \psi + \frac{|e|^2 H^2}{2m^* c^2} x^2 \psi + \alpha\psi + \beta|\psi|^2\psi = 0 \quad (4)$$

となる。 $\omega_c = |e^*|H/m^*c$ とし、薄膜は z, y 方向に無限に広いとすれば

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{m^*}{2} \omega_c^2 x^2 \psi + \alpha\psi + \beta|\psi|^2\psi = 0 \quad (5)$$

となる。

*このノートは家先生の出されたレポート課題の解答をまとめなおしたものである

2 $H = 0$ のとき

2.1 無次元化

式(5)を無次元化する。磁場が零で秩序パラメータが空間によらないときの解 $|\psi_\infty|^2 = -\alpha/\beta$ を用いて、 $\psi(x) = f(x)\psi_\infty$ とおくと、式(5)は

$$\psi_\infty \left(-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{m^*}{2} \omega_c^2 x^2 f + \alpha f - \alpha |f|^2 f \right) = 0 \quad (6)$$

となり、さらに $\psi_\infty \neq 0$ ($T < T_c$)、 $\xi^2 = \hbar/2m^*|\alpha|$ と、 f を実数としてもよいことを用いて書き直せば

$$-\xi^2 \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{m^*}{2|\alpha|} \omega_c^2 x^2 f - f + f^3 = 0 \quad (7)$$

となる。

2.2 線形 GL 方程式

f の三次の項を落とすことができれば、方程式は線形微分方程式になり解くのが容易になる。そのための条件は、 $f \ll 1$ である。条件を満たしそうなのは、 $\psi \rightarrow 0$ となる上部臨界磁場近傍と臨界温度近傍であろう。

超伝導体は上部臨界磁場を越えると、 $\psi = 0$ となる。 $\psi = f\psi_\infty$ であり、 ψ_∞ は磁場に拠らない定数なので $\psi \rightarrow 0$ のとき $f \rightarrow 0$ となる。したがって、 $f \ll 1$ の領域が存在し、上部臨界磁場近傍で

$$-\xi^2 \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{m^*}{2\alpha} \omega_c^2 x^2 f = f \quad (8)$$

という線形 GL 方程式を用いてもよいということになる。

臨界温度において $\psi \rightarrow 0$ となる。しかし $\psi_\infty \rightarrow 0$ となるので $f \ll 1$ である領域が存在するとは限らない。線形 GL 方程式を適用してよいかどうかを確かめるには、線形 GL 方程式が成り立つとして得られた f が臨界温度近傍で $f \ll 1$ を満たしているか確かめればよい。あるいは、 $f(T) \ll \psi_\infty$ であることを確かめればよい。

2.3 $H = 0$ のときの線形 GL 方程式の妥当性

磁場がないときの線形 GL 方程式を解き、その解が $f \ll 1$ であるかどうかを検証する。

線形 GL 方程式は

$$-\xi^2 \frac{d^2 f}{dx^2} = f \quad (9)$$

とかける。この方程式の一般解は

$$C \cos(x/\xi) + D \sin(x/\xi) \quad (10)$$

である。 $T < T_c$ においては薄膜は超伝導状態である必要があるので、 $x = 0$ で f の正負が変化してしまう sin 的解は存在しないということがわかり、 $D = 0$ である。また、境界条件 $\psi(\pm d/2) = 0$ を満たすためには

$$\frac{d}{2\xi} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \quad (11)$$

となり、解は

$$f = C \cos \left(\frac{2}{d} (n + 1/2) \pi x \right) \quad (12)$$

となる。薄膜は超伝導状態なので $-d/2 < x < d/2$ で $f > 0$ である必要があるから $n = 0$ である。よって、

$$f = C \cos \left(\frac{\pi}{d} x \right) \quad (13)$$

となる。

係数の決定

係数の決定を行わなければならない。以下のように係数の決定を行ったのだが、間違っていると思われる。

$d \rightarrow \infty$ のとき、 $x = 0$ での値は ψ_∞ に一致し、 $\xi \rightarrow \infty$ のとき境界条件から $f \rightarrow 0$ になる必要があるので、 $C = e^{-\xi/d}$ でなければならないことがわかり、結局

$$f = e^{-\xi/d} \cos\left(\frac{\pi}{d}x\right) \quad (14)$$

が解となる。上の係数の決定法は、 $d \rightarrow \infty$ のとき線形 GL 方程式の解が線形ではない GL 方程式の解と一致するということを要請している。したがって、自明ではなく、正しいかどうか不明である。申し訳ないのだが、以後もこの方法で係数を決定して議論している。非線形 GL 方程式を解くことで決着をつけたいと思っている。

転移温度変化

$\xi \gg d$ のときのみ、 f は $f \ll 1$ を満たしている。したがって、 $H = 0$ のときには、 $\xi \gg d$ が線形 GL 方程式の適用可能な領域¹である、結局、

$$|\psi|^2 = -\frac{\alpha}{\beta} e^{-2\xi/d} \cos^2\left(\frac{\pi}{d}x\right) \quad (15)$$

である。

$x = 0$ における $|\psi(x=0)|^2$ の温度依存性は $t = T - T_c$ として

$$|\psi(x=0)|^2 = -\frac{\alpha't}{\beta} \exp\left(-\frac{\hbar^2}{m*d} \frac{1}{\alpha't}\right) \quad (16)$$

となる。ここで、 $\alpha = \alpha'(T - T_c)$ を用いた。

このようなやりかたでは、臨界温度に向かっていくときの振る舞いはわかっていても、臨界温度自体がシフトするという結果はでない。厳密に行うにはやはり非線形微分方程式を解くべきなのだろう。 $H = 0$ であれば、ぎりぎり解析的に解けるとされる。機会をみて計算したいと思っている。

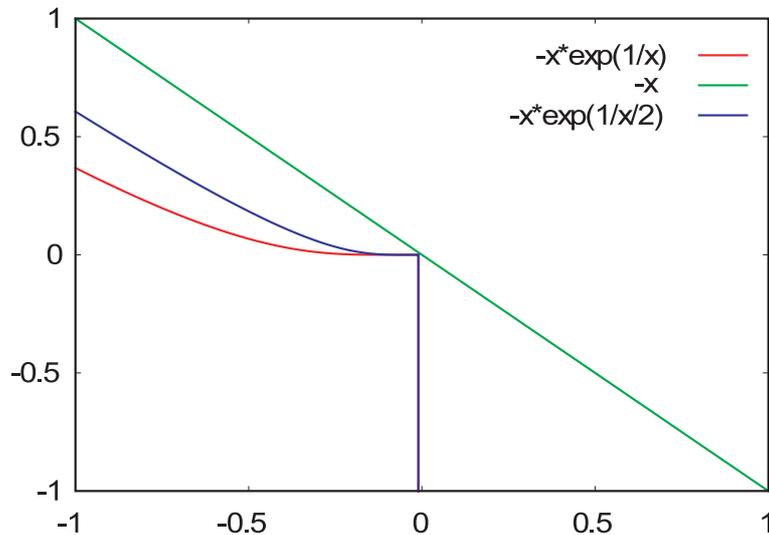


図 1: $|\psi|^2$ の温度依存性の概形。赤：薄膜、青：赤より二倍厚い薄膜、緑：パルク。薄膜の場合、ある程度臨界温度手前で 0 に限りなく近くなっているのが見て取れる

¹このように書いたが、実際は係数の決定が怪しいので、実際は磁場零では線形 GL 方程式は使えないと結論付けるしかない。

3 平行磁場のもとでの上部臨界磁場の導出

3.1 線形 GL 方程式

磁場が大きいときには線形 GL 方程式を用いることができる。式 (8) を

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*} \frac{d^2 f}{dx^2} = \left(-\alpha - \frac{m^*}{2} \omega_c^2 x^2 \right) f \quad (17)$$

のように書き直す。磁場のエネルギーの平均は

$$\frac{1}{2} \int_{-d/2}^{d/2} \frac{m^*}{2} \omega_c^2 x^2 dx = \frac{m^*}{24} \omega_c^2 d^2 \quad (18)$$

であるから、磁場のエネルギーを平均値とする近似を行うと、式 (17) は

$$\xi_H^2 \frac{d^2 f}{dx^2} = -f \quad (19)$$

とかくことができる。ここで、 $\xi_H^{-2} = \frac{2m^*}{\hbar^2} \left(-\alpha - \frac{m^*}{24} \omega_c^2 d^2 \right)$ とおいた。よって、解は

$$f = C \cos \left(\frac{\pi}{d} x \right) \quad (20)$$

となる。ここで、 $\xi_H^{-1} = \pi/d$ である。上部臨界磁場に到達すると ($H \rightarrow H_c$)、 $\xi \rightarrow \infty$ になり、超伝導状態から常伝導状態に移行する。したがって、

$$\frac{2m^*}{\hbar^2} \left(-\alpha - \frac{m^*}{24} \omega_c^2 d^2 \right) = 0 \quad (21)$$

を満たす磁場が上部臨界磁場である。 $\alpha = \alpha'(T - T_c)$ であるので、

$$H_c = \left(\frac{24m^*c^2}{|e|^2d^2} \alpha'(T_c - T) \right)^{1/2} \quad (22)$$

となる。

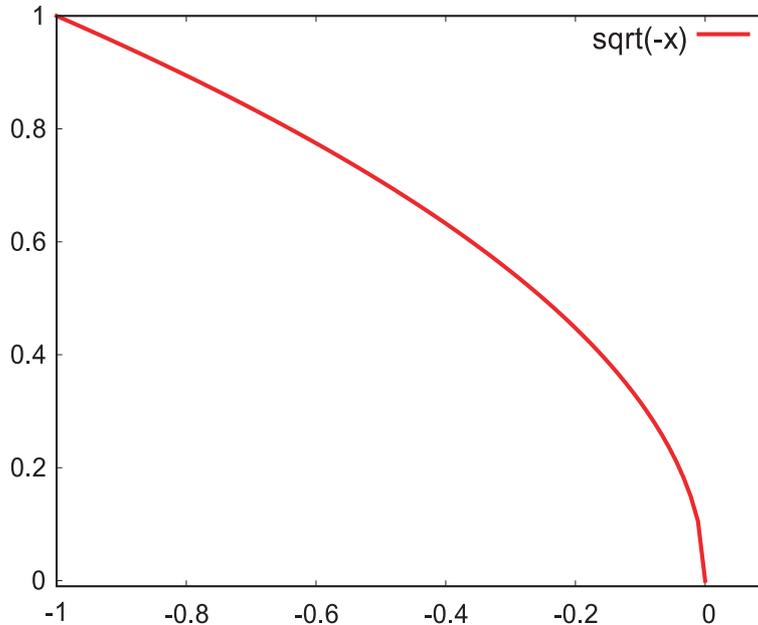


図 2: 上部臨界磁場の温度依存性の概形

参考文献

アプリコソフ、「金属物理学の基礎」(吉岡書店 1995)

Michael Tinkham, "Introduction to Superconductivity" 2nd ed. (McGraw-Hill, 1996)

伊達宗行監修 「大学院物性物理 2 : 強相関電子系」(講談社サイエンティフィック)

P. G. De Gennes, "Superconductivity of Metals and Alloys"

中嶋貞雄 「超伝導入門」(培風館)